

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 12 月 2 日 (2005.12.2)

【公開番号】特開 2001-92138 (P2001-92138A)

【公開日】平成 13 年 4 月 6 日 (2001.4.6)

【出願番号】特願 平 11-277377

【国際特許分類第 7 版】

G 0 3 F 7/039

C 0 8 K 5/23

C 0 8 L 77/06

G 0 3 F 7/022

G 0 3 F 7/037

H 0 1 L 21/027

【F I】

G 0 3 F 7/039

C 0 8 K 5/23

C 0 8 L 77/06

G 0 3 F 7/022 6 0 1

G 0 3 F 7/037 5 0 1

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 10 月 19 日 (2005.10.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

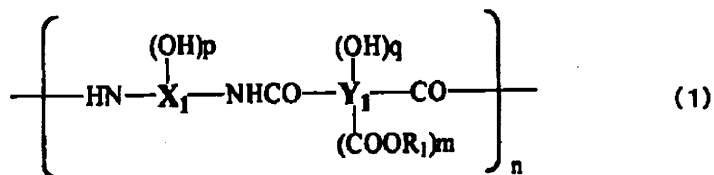
【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (a) 一般式 (1) で示される繰返し単位を有するポリアミド 100 重量部と、

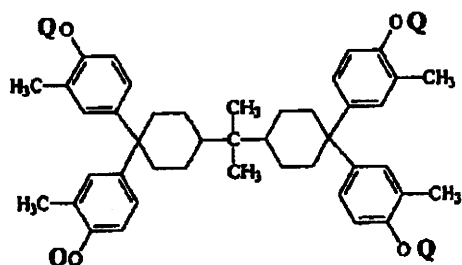
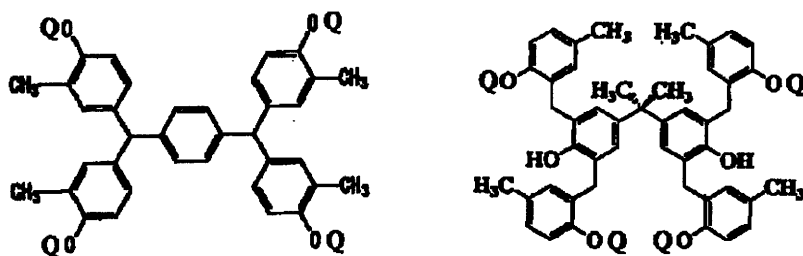
【化 1】



(式中 X1 は少なくとも 2 個以上の炭素原子を有する 2 ~ 4 価の有機基、Y1 は少なくとも 2 個以上の炭素原子を有する 2 ~ 6 価の有機基、p、q は 0 または 1 ~ 4 の整数、R1 は水素、または炭素数 1 ~ 20 までの有機基であり、p、q 共に 0 の場合フェノール性水酸基を少なくとも 1 つ有する、n は 2 ~ 1000 までの整数、m は 0 または 1 ~ 2 の整数、ただし m、p、q が同時に 0 であることはない。)

(b) 下記一般式 (2) で表される感光性ジアゾキノン化合物 1 ~ 100 重量部を必須成分とするポジ型感光性樹脂組成物。

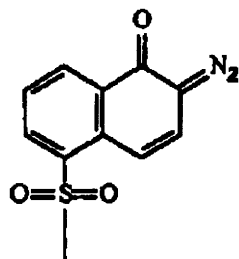
【化 2】



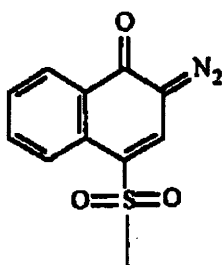
(2)

(式中、Qのうち少なくとも1個は下記で示される基であり残りは水素原子である。)

【化3】

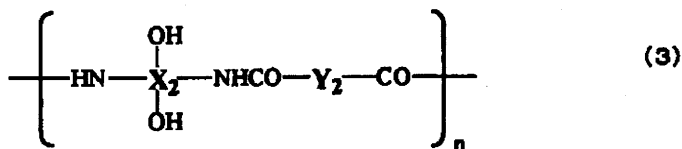


又は



【請求項2】 ポリアミドが式(3)で示される繰返し単位を有することを特徴とする請求項1記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【化4】



(式中X2は4価の芳香族基、Y2は2価の芳香族基、nは上記と同じ)

【請求項3】 請求項1ないし2のいずれか1つに記載のポジ型感光性樹脂組成物を層またはフィルムの形で基板に施し、マスクを介して化学光線で露光するか又は、光線、電子線又はイオン線を直接照射した後、その露光部又は照射部を溶出又は除去し、次に得られたレリーフ構造物を焼結することを特徴とする高耐熱性レリーフ構造物の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

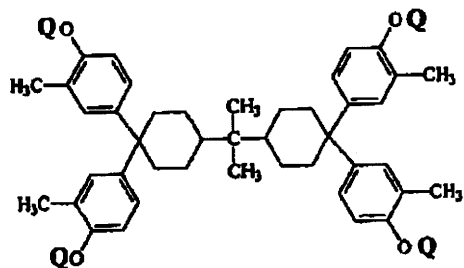
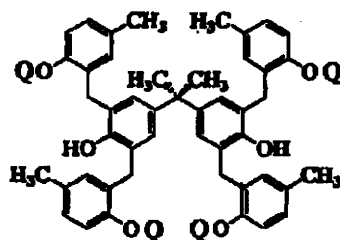
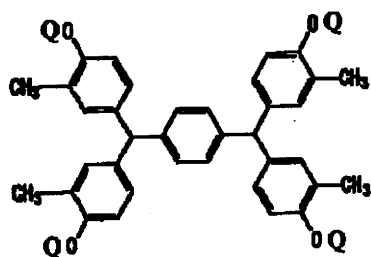
【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

【化 7】



(2)

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

( 式中、Qのうち少なくとも1個は下記で示される基であり残りは水素原子である。 )